

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年9月19日(19.09.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/190380 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 83/04 (2006.01) B01D 71/64 (2006.01)
B01D 61/14 (2006.01) C08K 5/5415 (2006.01)
B01D 69/00 (2006.01) G03F 7/075 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/006751
- (22) 国際出願日: 2024年2月26日(26.02.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-042391 2023年3月16日(16.03.2023) JP
- (71) 出願人: 東京応化工業株式会社 (TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.) [JP/JP]; 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 Kanagawa (JP).
- (72) 発明者: 野口 拓也 (NOGUCHI Takuya); 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP).
細谷 守 (HOSOYA Mamoru); 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 田 ▲ 崎 ▼ 聡, 外 (TAZAKI Akira et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,

(54) Title: SILICON-CONTAINING RESIN COMPOSITION PURIFIED PRODUCT MANUFACTURING METHOD, PATTERN FORMATION METHOD, AND SILICON-CONTAINING RESIN COMPOSITION PURIFIED PRODUCT

(54) 発明の名称: ケイ素含有樹脂組成物精製品の製造方法、パターン形成方法、及びケイ素含有樹脂組成物精製品

(57) Abstract: This silicon-containing resin composition purified product manufacturing method comprises a step for filtering a silicon-containing resin composition by using a filter having a porous structure in which adjacent spherical cells are connected. The filter is provided with a porous film containing at least one resin selected from the group consisting of polyimides and polyamide imides. The silicon-containing resin composition contains: a silicon-containing resin (A) in which the main chain comprises siloxane bonds; a siloxane bond-containing cage compound other than the silicon-containing resin (A); and an organic solvent component. The manufacturing method enables manufacturing of a silicon-containing resin composition purified product which has less impurities and in which occurrence of defects when forming a coating film is suppressed.

(57) 要約: ケイ素含有樹脂組成物を、隣接した球状セル同士が連通した多孔質構造を有するフィルターで濾過する工程を含む、ケイ素含有樹脂組成物精製品の製造方法を採用する。フィルターは、ポリイミド及びポリアミドイミドからなる群より選択される少なくとも一種の樹脂を含有する多孔質膜を備える。ケイ素含有樹脂組成物は、主鎖がシロキサン結合からなるケイ素含有樹脂(A)と、ケイ素含有樹脂(A)以外のシロキサン結合含有かご型化合物と、有機溶剤成分とを含有する。かかる製造方法によれば、不純物がより低減され、かつ塗布膜形成の際の欠陥の発生が抑制されたケイ素含有樹脂組成物精製品を製造することができる。

[続葉有]

WO 2024/190380 A1

CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）